

## EV GROUP Advances Leadership in Optical Lithography With Next-generation EVG150 Resist Processing Platform – November 10, 2022

新聞 新聞詳情

### EV Group透過次世代EVG150光阻製程平台擴大在光學微影領域的領先優勢

2022-11-10 13:22:33



台北, 2022年11月10日 – 微機電系統 (MEMS)、高半科技與半導體市場的巨擘綜合微影技術設備領導廠商EV Group (EVG), 今天宣布發表次世代200毫米版本的EVG150自動化光阻製程系統, 強化該公司的光學微影解決方案產品組合。重新設計的EVG150平台包括先進功能與強化項目, 與前一代平台相比可提供更高的製程產出 (最多高出90%)、通用性, 以及更小的設備佔地面積 (減少近50%)。EVG150在通用的平台上提供可靠且高品質的零件與顯影製程, 可支援各種裝置與應用, 包括先進封裝、微機電系統、無線射頻 (RF)、3D感測、功率元件以及光子元件。EVG150極高的製程產出、彈性與再周性, 能支援大規模生產與工業開發所做的超量需求。

電子控制系統 (ECS) 產業的頂尖研究中心Silicon Austria Labs是第一個採用次世代EVG150系統的客戶。Silicon Austria Labs微系統研究部門負責人Mohssen Moridi博士表示:「早在工業4.0、物聯網、自動駕駛、遠端整合系統 (CPS)、人工智慧、智慧城市、智慧能源與智慧醫療市場, 我們就透過與行業界的製造商共同研究, 開發出奠定上述應用基礎的關鍵技術。EVG的次世代EVG150光阻製程系統的高產彈性, 為我們客戶的全新製程與產品的大規模導入打好基礎, 並推動ECS的創新。」

#### 通用平台提供前所未見的彈性

為200毫米基板設計的次世代EVG150保留前一代平台引領業界的功能, 包括具有全自動化功能的可客製化的旋轉與噴霧式塗佈、顯影、烘烤與冷卻模組; EVG專有的OmniSpray™技術, 可因應複雜形狀的成形塗佈; 精密且超現場敏感的機械化處理, 再變半圓球片可獲得持續的高製程產出; 以及晶圓邊緣、凸點、懸柱及薄化晶圓的處理。

次世代EVO150 200晶舟平台的全新功能包括：

- 最多達四個單式製程槽組的空間，以及高達20個槽組/ 晶舟單元，可以同時處理更多的晶圓。
- 獨立的光阻塗佈腔使槽組間完全隔離，防止完全排時槽組間交叉污染。
- 槽組再通過進一步重新設計，可從設備外部更容易地更換腔體，獲得最小的停機時間，且在進行腔體保養時也可持續操作設備。
- 系統內部的液體管理重新位置，以便更容易以機械化處理來進行保養。
- 具有影像功能的預烘系統，可以隨時進行晶圓表面溫度加熱製程。
- 整合系統內部的光阻與化學液管理線，可以減少儲存化學液體的槽外機械空間，並降低設備的佔地面積。
- 將使用者介面整合於系統內，可以進一步降低設備的佔地面積。

EV Group企業技術總監Thomas Glinner博士表示：「光阻製程與晶舟化晶半導體製造中位置進行最多次的製程步驟，EVO已經針對這些製程累積了多年的經驗，包括光學微影、旋轉與噴霧式塗佈，以滿足最廣泛的客戶需求。我們將這些經驗融入次世代的EVO150系統中。這套系統經全面性的重新設計，可在通用平台上提供突破性的製程產出與擁有成本效益，提供最高質比的彈性，以滿足最廣泛的光阻製程需求。」

#### 產品供應時程

EVO已經開始接受各界對次世代EVO150自動化光阻製程系統的訂單。您在公司總部提供產品展示。更多相關資訊請瀏覽：<https://www.evgroup.com/products/lithography/resist-processing-systems/evg150/>。

#### 關於EV Group (EVO)

EVO是全球半導體、矽電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶圓製程解決方案領導廠商。主要產品包括晶圓塗佈、晶圓噴霧、微影/ 奈米壓印微影技術 (NIL) 和檢測設備，以及3D噴塗機、雷射機、晶圓清洗和檢測設備。EVO成立於1990年，藉由一個完善的全球網絡資源為全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊參考公司網站：[www.EVGroup.com](http://www.EVGroup.com)。

EVOGROUP EVO EVO150

<https://nb.aotter.net/post/636c8cf1a21f9261a7f66492>